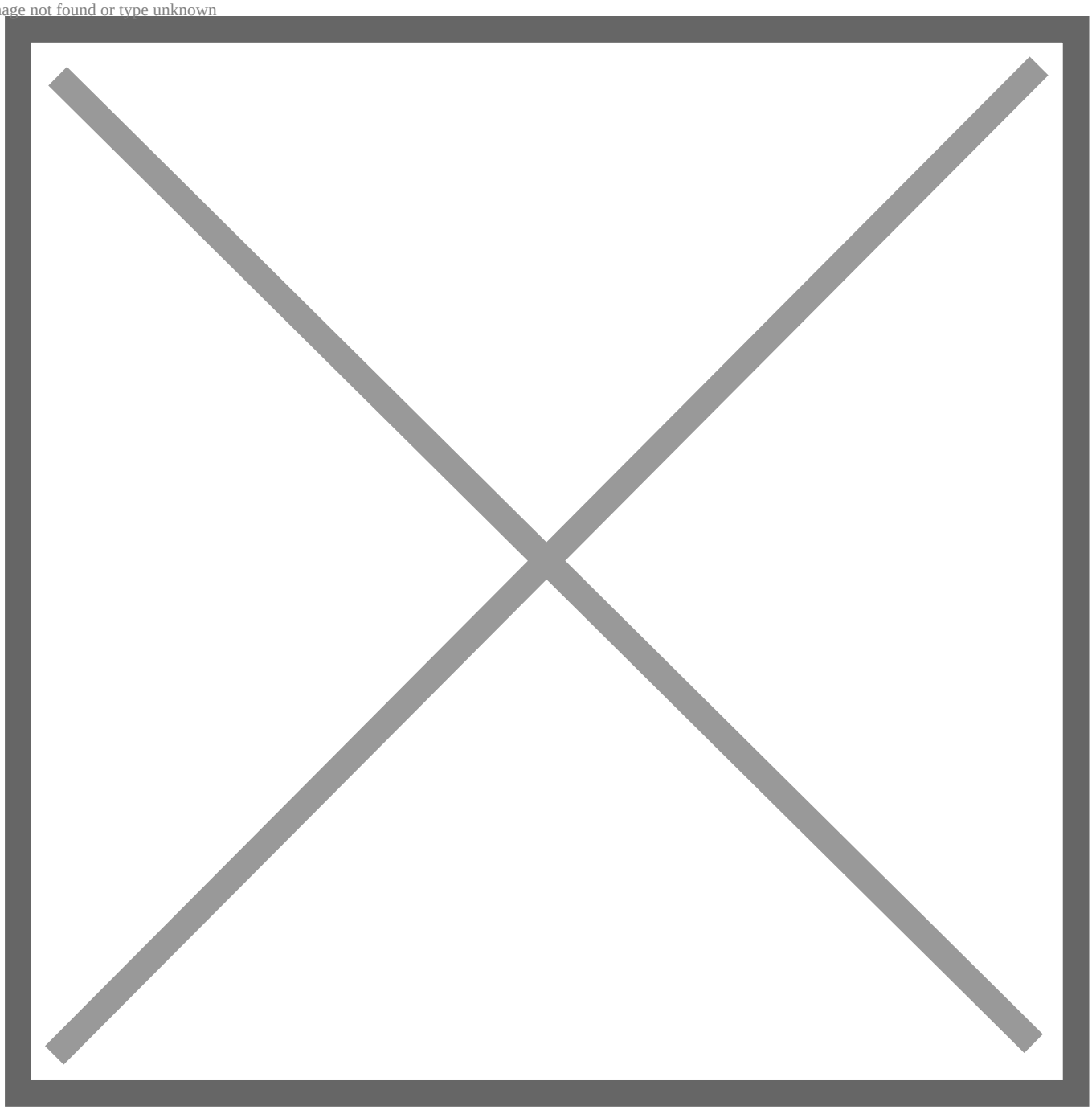
+7 (812) 702 – 12 – 66 info@dipaul.ru

Установка плазмохимического осаждения Vision 310 PECVD

Image not found or type unknown



Производитель:	Цена:
Plasma-Therm	Цена по запросу

Описание

Установка плазмохимического осаждения Vision 310 PECVD компании Plasma-Therm— это компактная, надежная, технологически гибкая и простая в

эксплуатации и обслуживании установка плазмостимулированного осаждения из газовой фазы для R&D-лабораторий и мелкосерийных производств.

Установка Vision 310 PECVD позволяет осаждать следующие материалы:

- Диэлектрики: SiO2, SiNx, SiOxNy.
- Полупроводниковые материалы: SiC, a-Si.

Ключевые преимущества установки Vision 310 PECVD:

- Большая область загрузки — круглый стол диаметром 305 мм, который позволяет обрабатывать подложки разных форм и размеров.
- Изменяемое расстояние между газовым душем и электродом.
- Равномерность осаждения по толщине и воспроизводимость результатов от пластины к пластине — лучше ±2%.
- В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных технологических процессов, которые гарантируются производителем.
- Простой, интуитивно понятный интерфейс.
- История аварийный сообщений, контроль рецептов в процессе работы — вывод данных о процессе на дисплей в режиме реального времени.
- Программное обеспечение позволяет записывать параметры процессов для дальнейшего анализа.
- Возможность удаленного управления и контроля состояния системы.
- Многоуровневый доступ пользователей.
- Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания процесса (OES, OEI, LEPD).
- Современная архитектура на основе ПЛК и DeviceNet: безопасная работа, легкая диагностика и минимальное количество проводов.
- Простота использования и обслуживания.
- Малая занимаемая площадь <0,7 м2.
- Возможность установки через стену чистого производственного помещения.
- Опциональное оснащение боксом для работы с токсичными и коррозионными газами.
- Возможность изготовления опций и оснастки «под заказ».

Основные опции

- Система отслеживания окончания процесса:
  - Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES)
  - Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI)
  - Лазерная интерферометрия (LEPD)
- Сухой форвакуумный насос

- Дополнительные газовые линии (до 10 в сумме)
- Расширение температурного интервала электрода (например, –25...+60 С, либо диапазон на заказ)
- Перчаточный бокс
- Специальные держатели образцов
- Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта
- Удаленный мониторинг состояния системы SECS/GEM
- Пакет для установки через стенку ЧПП
- Размещение газового шкафа отдельно от каркаса установки
- Расширенная гарантия производителя
- Специальные опции под заказ

Основные технические характеристики установки Vision 310 PECVD

Размер электрода	12″ (305 мм) в диаметре
Температура электрода	+40...380 °C
Материал электрода	Алюминий. Опционально доступны другие материалы
Тип плазмы	Емкостная
ВЧ-генератор	300 Вт, 13,56 МГц. Опционально генератор LF
Вакуумная камера	Изготовлена из цельного блока алюминия. Опциональная внешняя система прогрева
Откачная система	Форвакуумный насос 250 м3/ч, масляный или безмасляный Возможна установка других насосов по ТЗ заказчика
Уровень вакуума	<10-6 торр
Контроль давления процесса	Автоматический
Газовые линии с цифровыми РРГ	5 линий (стандартно). Опционально до 10 линий
Система контроля, ПО	ПЛК (XP/Windows 7), DeviceNet
Электропитание	380 В, 50 Гц, 3 фазы

Габариты установки (Ш×Г×В)	730×934×2147 мм с газовым шкафом на каркасе 730×934×1172 мм без газового шкафа на каркасе Возможно размещение газового шкафа отдельно от каркаса установки
Сертификация	CE, SEMI-2, S8